## СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЁНОК С«О, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ БОРА

Шпилевский Э. М., Баран Л. В. Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, shpilevsky@bsu. by

Красницкий В. Я., Трубило А. М. НИКТП «Белмикросистемы», г. Минск, Беларусь

Для практического использования фуллеренсодержащих материалов в различных областях науки и техники очень важно понимание процессов, происходящих в этих материалах при воздействии ускоренных заряженных частиц.

Фуллереновые плёнки были получены методом сублимации в вакууме не хуже 1,3-10" Па на установке ВУП-5М. В качестве исходного материала использовался фуллереновый порошок Сбов виде мелких кристаллитов со средним размером 80...200мкм. Молекулы Сбо осаждались на окисленную монокристаллическую кремниевую пластину, нагретую до температуры 150 °C. Сублимация фуллеренов происходила при температуре испарителя 500 °C. Скорость осаждения фуллереновой плёнки составила ~1 нм/с. Образцы имплантировались ионами В (£=80 кэВ) до дозы  $5\text{TO}^{16}$  ион/см<sup>2</sup>. Фазовый состав образцов дифрактометре контролировался на ЛРОН-З.О в Ка-излучении с применением системы автоматизации на базе персонального компьютера, включающей все функции управления гониометром. Сбор, обработка и анализ полученных данных проведен с помощью пакета программ [1].

Методом ренттеновской дифрактометрии установлено, что структура кристаллитов исходного фуллеренового порошка гранецентрированная кубическая с параметром решётки а = 14,308 А. При осаждении на подложку молекулы Сео образуют кристаллическую структуру с гексагональной плотноупакованной решёткой (а = 10,020 A, c = 16,381 A), груп-

па симметрии Рбз/тте. На дифрактограмме также прису тствует ряд линий небольшой интенсивности, которые индицируются в предположении гексагональной сингонии (a = 10,020 A, c = 16,162 A), группа симметрии Рб/штш. Фуллереновая плёнка зеркальная, однородная, без каких-либо включений и нарушений сплошности. Удельное электросопротивление плёнки составило  $\sim 10^5$  Омсм, что согласу ется с литературными данными [2].

Имплантация фуллереновой плёнки ионами В ( $\Gamma=80~{\rm кзB}$ ) до дозы  $5{\rm T0}^{16}$  ион/см" приводит к значительным структурно-фазовым изменениям. Происходит разупорядочение в фуллеритовой фазе, часть молекул Скі разрушается. На дифрактограмме появляются новые дифракционные максимумы, идентифицируемые как карбиды бора В4С и **В25С,** образованные в результате фрагментации молекул фу ллерена и взаимодействия атомов углерода с ионами бора.

Удельное электрическое сопротивление плёнки уменьшается после ионной имплантации и достигает значения 741 мкОм-см, что меньше, чем удельное сопротивление монокристаллического графита (2630 мкОм-см). Такое уменьшение сопротивления связано с образованием аморфной углеродной фазы, карбидов бора и, возможно, с частичной полимеризацией фуллеритовой фазы в результате ионного воздействия.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант Ф01-116).

## Литература

- 1. Система автоматизации рентгеновских дифрактометров серии «ДРОН».-Программа X-Ray, версия 2.0. Руководство пользователя,— М.: МГУ, 1995.-44 с.
- Degiorgi Leonardo. Fullerenes and carbon derivatives: from insulators to superconductors // Adv. Phys. 1998. V. 47, № 2. P. 207—316.